

レーザーCVD装置 CL-12000



<レーザーCVD>

高出力エキシマレーザーを使って、ヒーターの埋め込まれた100mm角の基板ホルダー上に成膜するレーザーCVD装置です。基板は、X-Yに連動して動かすことができます。

レーザーCVD装置CL-12000仕様

○膜種	C
○炉体サイズ	φ440mm×600mm
○炉体材質	SUS316
○基板形状	4インチ 1枚
○到達圧力	×10 ⁻⁴ Pa台※常温・無負荷・脱ガス時
○排気速度	×10 ⁻⁴ Pa台迄10分以内※常温・無負荷・脱ガス時
○加熱温度	600℃
○圧力コントロール	自動
○ガス種	CH ₄ /C ₂ H ₂ /C ₂ H ₆ /N ₂
○電源	高出力レーザー
○真空排気系	油回転ポンプ:375L/min メカニカルブースターポンプ:100m ³ /h
○真空計	ピラニ真空計/バロトロン真空計
○ユーティリティ	電気: AC200V三相60KVA 冷却水: 50L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環 計装エア: 0.5MPa以上